

課題番号 : F-16-FA-0018
利用形態 : 機器利用
利用課題名(日本語) : OH ラジカル水のレジスト剥離
Program Title (English) : Photoresist Removal by OH Radical
利用者名(日本語) : 張 文皓¹⁾, 樋口 友彦²⁾
Username (English) : Wenhao Zhang¹⁾, T. Higuchi²⁾
所属名(日本語) : 1)2)株式会社フジコー
Affiliation (English) : 1)2) FUJICO, Co. Ltd.

1. 概要(Summary)

OH ラジカル水を利用しレジスト剥離性能の評価試験。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

OH ラジカル水発生装置。

超純水生成装置

【実験方法】

OH ラジカル水を利用し、レジスト表面洗浄。レジストの剥離程度を測定する。

試験装置の外観は以下



Fig1. Photoresist Removal Equipment

3. 結果と考察(Results and Discussion)

OH ラジカル水より、短時間でレジストの剥離は可能です。

レジスト剥離の電子顕微鏡から調査結果写真は以下

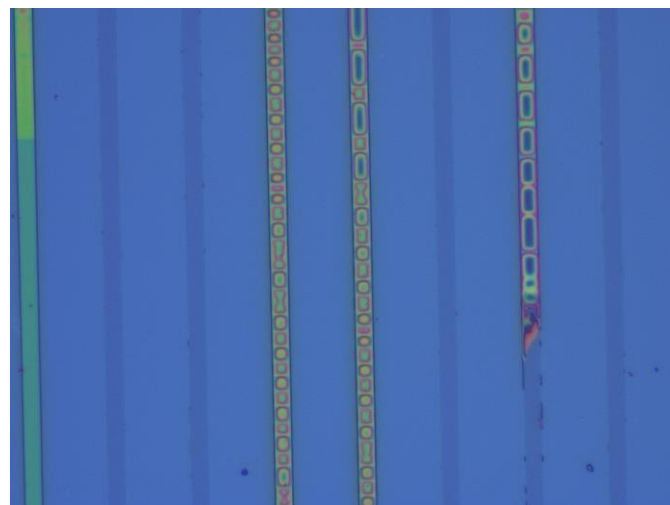
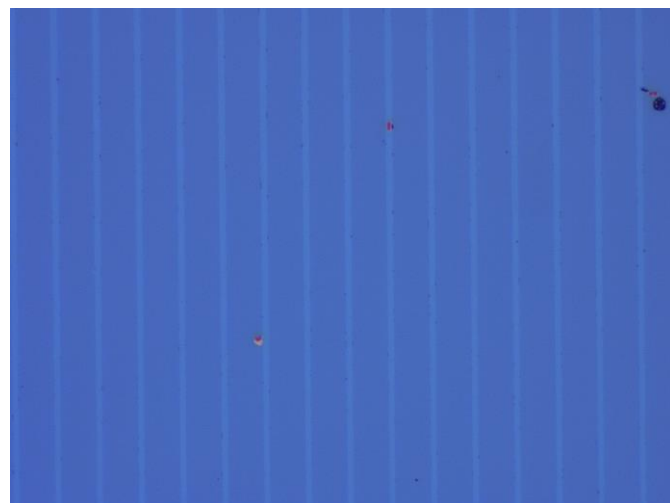


Fig2. Photoresist Removal by OH Radical

4. その他・特記事項(Others)

社内知的財産検討中。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし

6. 関連特許(Patent)

なし